

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 29 年 10 月 19 日 (2017.10.19)

【公開番号】特開 2016-58446 (P2016-58446A)
【公開日】平成 28 年 4 月 21 日 (2016.4.21)
【年通号数】公開・登録公報 2016-024
【出願番号】特願 2014-181471 (P2014-181471)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

H 0 1 L 21/306 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 4 3 A

H 0 1 L 21/306 R

【手続補正書】
【提出日】平成 29 年 9 月 6 日 (2017.9.6)

【手続補正 1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板を収容し、収容した前記基板の処理対象面に向けて清浄な空気が流れる処理室と、
前記処理室内の前記基板の処理対象面に処理液を供給するノズルと、
前記空気の流れを妨げる位置から前記処理室内の前記基板の処理対象面を加熱する加熱部と、

前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に前記加熱部を移動させる移動機構と、
を備えることを特徴とする基板処理装置。

【請求項 2】

前記移動機構は、前記ノズルにより前記処理液が前記処理室内の前記基板の処理対象面に供給されている状態で、前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に前記加熱部を移動させることを特徴とする請求項 1 に記載の基板処理装置。

【請求項 3】

前記加熱部は、前記処理室内の前記基板の処理対象面に前記処理液を供給している状態の前記ノズルを避けて移動するための切欠き部を有していることを特徴とする請求項 2 に記載の基板処理装置。

【請求項 4】

前記加熱部は、前記加熱部の端部を回転中心として回転可能に形成されており、
前記移動機構は、前記加熱部を回転させて前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に前記加熱部を移動させることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか一項に記載の基板処理装置。

【請求項 5】

前記加熱部は、複数に分割可能に形成されており、
前記移動機構は、前記加熱部を複数に分割して前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に移動させることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか一項に記載の基板処理装置。

【請求項 6】

前記処理室は、複数設けられており、

前記ノズルは、前記処理室ごとに設けられており、

前記移動機構は、前記複数の処理室のうち第１の処理室の前記空気の流れを妨げる位置から、前記第１の処理室の前記空気の流れを妨げない位置として前記第１の処理室以外の第２の処理室の前記空気の流れを妨げる位置に前記加熱部を移動させることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか一項に記載の基板処理装置。

【請求項７】

基板を収容する処理室内の前記基板の処理対象面に向けて清浄な空気を流す工程と、

前記空気が前記処理室内の前記基板の処理対象面に向かって流れている状態で、前記処理室内の前記基板の処理対象面に処理液を供給する工程と、

前記処理液を供給する工程前又は途中から、前記空気の流れを妨げる位置に存在する加熱部により前記処理室内の前記基板の処理対象面を加熱する工程と、

前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に前記加熱部を移動させる工程と、

を有することを特徴とする基板処理方法。

【請求項８】

前記加熱部を移動させる工程では、前記処理液が前記処理室内の前記基板の処理対象面に供給されている状態で、前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に前記加熱部を移動させることを特徴とする請求項７に記載の基板処理方法。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００８

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００８】

実施形態に係る基板処理装置は、基板を収容し、収容した前記基板の処理対象面に向けて清浄な空気が流れる処理室と、前記処理室内の前記基板の処理対象面に処理液を供給するノズルと、前記空気の流れを妨げる位置から前記処理室内の前記基板の処理対象面を加熱する加熱部と、前記空気の流れを妨げる位置から前記空気の流れを妨げない位置に前記加熱部を移動させる移動機構とを備える。